

第86回応用物理学会秋季学術講演会シンポジウム T15：原子層プロセス（ALP: Atomic Layer Process）の解析技術と応用技術（2）

日時：2025年9月7日(日) 9:00-17:30（予定）

会場：名城大学 天白キャンパス（応用物理学会会場内）

開催趣旨

微細化や三次元化が進む半導体製造プロセスにおいて、原子層堆積（ALD：Atomic Layer Deposition）や原子層エッチング（ALE：Atomic Layer Etching）などの原子層プロセス（ALP：Atomic Layer Process）は益々重要性を増しています。その反応メカニズムや速度論等の基礎は、応用分野を超えた共通性があります。このようなプロセスサイエンスとALPの最先端技術動向を議論し、選択成長・エッチング（ASD/ASE：Area Selective Deposition/Etching）等の革新的なプロセス設計を検討する場を提供したいと考えています。材料・デバイス・プロセス関連の幅広い分野の研究者・技術者の方々の参加を期待しており、一般講演も募集しています。

【招待講演者】

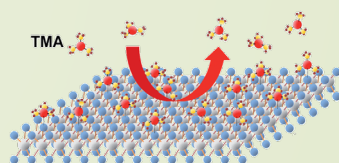
Hyeongtag Jeon (Hanyang Univ., Korea)
「20 years history of Korea ALD Workshop」

高島 準也 (ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社)
「in-situ分光エリプソメーターによる成膜プロセスモニタリング」

富田 勇人 (LayTec AG)
「in-situ “見える化”によるALD/ALEプロセス間統合と最適化」

豊田 紀章 (兵庫県立大)
「クラスタービームによる表面改質と原子層プロセスへの応用」

京兼 広和 (東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社)
「機械学習と数理モデルを用いた半導体成膜プロセスの開発」



主催：プラズマエレクトロニクス分科会，シリコンテクノロジー分科会

世話人：霜垣幸浩（東京大学），浜口智志，唐橋一浩（大阪大学），百瀬健（熊本大学）

※ 一般講演募集中（2025年6月17日 17時締切）

※ 協賛募集中（プログラム記載，会場での資料配布および展示）